

پوشش دو لایه HA/TiO_2 بر روی زیرلایه $\text{Ti}-6\text{Al}-4\text{V}$ به روش کند و پاش مگنترون RF

حمید جعفری^۱، مرتضی تمیزی‌فر^{۲*}، علی نعمتی^۳

^۱ دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

^۲ دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت

^۳ دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

* tamizifar@iust.ac.ir

چکیده:

در تحقیق حاضر، لایه‌هایی از HA و TiO_2 با روش کند و پاش مگنترون AC و DC بر روی زیرلایه $\text{Ti}-6\text{Al}-4\text{V}$ پوشش داده شدند. در این جا با تعیین پارامترهای بهینه پوشش دهنی که برای هیدروکسی آپاتیت توان $W = 175$ و برای تک لایه تیتانیا نسبت آرگون به اکسیژن (Ar/O_2) $30/70$ بود، نمونه دو لایه HA/TiO_2 پوشش دهنی گردید. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، مورفوولوژی و زیری سطح به ترتیب از پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نیزروی اتمی (AFM) بهره گرفته شد. همچنین اثر دما در عملیات حرارتی بر رشد لایه هیدروکسی آپاتیت مورد بررسی قرار گرفت. با غوطه‌وری نمونه‌ها درون مایع شبیه‌سازی بدن (SBF) آزمایش خوردگی نیز انجام شد. نتایج XRD وجود فازهای HA و TiO_2 را در پوشش‌های مربوطه تأیید می‌کنند. ضمن این که مشاهده گردید با انجام عملیات حرارتی بر روی نمونه چند لایه، پیک‌های مربوط به HA رشد داشته و نیز مقاومت به خوردگی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص دانسیتی جریان خوردگی از مقادار $0.041 \mu\text{A} \cdot \text{cm}^2$ برای نمونه تک لایه هیدروکسی آپاتیت، به مقادار $0.007 \mu\text{A} \cdot \text{cm}^2$ و $0.003 \mu\text{A} \cdot \text{cm}^2$ به ترتیب برای نمونه با پوشش چند لایه عملیات حرارتی نشده و نمونه‌های چند لایه عملیات حرارتی شده در 500°C و 1000°C کاهش یافت. بدین ترتیب نمونه چند لایه عملیات حرارتی شده در 1000°C بهترین مقاومت به خوردگی را دارا بود. همچنین تصاویر SEM حاکی از تشکیل لایه نازکی از HA و TiO_2 با خصامتی در حدود 300 nm دارد. داده‌های AFM بیان می‌دارند که زیری سطح زیرلایه بدون پوشش با اعمال پوشش‌های تک لایه HA و TiO_2 و چند لایه HA/TiO_2 بهبود یافته است. طبق این داده‌ها نمونه‌های تک لایه HA و TiO_2 و HA زیری سطح تقریباً یکسان (در حدود 64 \AA) داشتند. در مورد نمونه چند لایه عملیات حرارتی نشده، عدد $73/5 \text{ \AA}$ بهبود خوبی در زیری سطح را نشان می‌دهد. برای نمونه چند لایه عملیات حرارتی شده در 1000°C این عدد به شدت افزایش یافته و شاهد رشد شدیدی بوده است که نشان از اثر بسیار مثبت انجام عملیات حرارتی بر خواص سطحی پوشش هیدروکسی آپاتیت می‌باشد.

اطلاعات مقاله:

دريافت: ۱۹ دی ۱۳۹۵

پذيرش: ۷ شهر يور ۱۳۹۶

كلید واژه:

هیدروکسی آپاتیت، لایه نازک، $\text{Ti}-6\text{Al}-4\text{V}$ ، کند و پاش مگنترون



۱- مقدمه

الکتریکی متغیر (فرکانس RF). ذکر این نکته ضروری است که کند و پاش مگنترون RF به طور ویژه‌ای در لایه‌نشانی لایه‌های نازک با تارگت‌هایی از مواد نارسانا مزیت دارد. این امر به منبع تغذیه RF و یک شبکه هماهنگ امپدانس^۴ میان مولد RF و تارگت برمی‌گردد. همچنین بایستی مذکور شد که بدون استفاده از یک مگنترون، ممکن است در تشکیل لایه نازک از مواد نارسانا مشکلات متعددی ایجاد گردد مانند واکنش شیمیایی میان ماده تارگت و گاز خنثای درون محفظه خلاء دستگاه. ترکیبات اکسیدی و نیتریدی نمونه‌هایی از لایه‌های نازک توسعه یافته با کند و پاش واکنشی^۵ هستند به طوری که ترکیبات لایه نازک آن‌ها با تنظیم فشار نسبی گازهای خنثی و واکنشی داخل محفظه خلاء، قابل کنترل می‌باشد [۱].

در لایه‌نشانی بیوسرامیک‌ها روش‌های متعددی وجود دارد، مانند پلاسمای اسپری، اسپری الکترواستاتیک، لیزر پالسی^۶، اکسیداسیون میکروقوسوی^۷، لایه نشانی سل-ژل و نیز کند و پاش مگنترون [۵-۷]. از آنجایی که پوشش‌دهی یک کاشتنی فلزی با سرامیک‌ها، کاهش آزادسازی یون از آلیاژ فلزی به بدن و به نوعی مقاومت به خوردگی بالاتر را به همراه دارد که خود یک مزیت است، استفاده از کند و پاش مگنترون در پوشش‌دهی کلسیم فسفات‌ها، یک روش ایده‌آل برای ایجاد لایه سرامیکی زیستسازگار بر روی کاشتنی‌های فلزی می‌باشد. در این جا با انتخاب پارامترهای لایه‌نشانی مناسب امکان ایجاد یک پوشش کلسیم فسفات (CaP) مطلوب و حتی پوشش‌های کامپوزیت وجود دارد.

⁴ Impedance matching network

⁵ Reactive sputtering

⁶ Pulsed laser

⁷ Micro-arch oxidation

در حال حاضر، کند و پاش مگنترون مؤثرترین فرآیند برای لایه‌نشانی طیف وسیعی از مواد لایه نازک می‌باشد. نیروی محركه اصلی در توسعه این روش تقاضای روز افزون برای لایه‌های نازک کاربردی و با کیفیت بالا در صنایع گوناگون می‌باشد. در بسیاری از موارد، لایه‌های ایجاد شده با روش کند و پاش مگنترون نسبت به لایه‌هایی که با سایر فرآیندهای PVD ایجاد شده‌اند، برتری‌هایی داشته است. در سیستم کند و پاش مگنترون، یک میدان مغناطیسی قوی در نزدیکی سطح تارگت ایجاد می‌شود که باعث انتقال الکترون‌ها به سمت شارهای مغناطیسی مارپیچ گونه^۱ می‌شود. این شرایط ایجاد پلاسمای نزدیکی سطح تارگت را در پی دارد بدون این که به لایه تشکیل شده بر روی سطح زیرلایه آسیب رسانده و تغییری در شرایط استکیومتری و یکنواختی ضخامت لایه نازک نشانده شده ایجاد کند. مضافةً این که در یک سیستم کند و پاش مگنترون RF الکترون‌های تولید شده مسافتی را طی می‌کنند؛ بنابراین احتمال یونیزاسیون بیشتر اتم‌های گاز خنثی (معمولًاً Ar^+) و تولید یک پلاسمای با تراکم بالای پایدار افزایش می‌یابد. به طور خلاصه، اتم‌های آرگون یونیزه شده سطح تارگت را بمباران کرده و آزادسازی مولکول‌ها / اتم‌ها و تشکیل لایه نازک بر روی زیرلایه را موجب می‌گردند [۱-۳].

کند و پاش مگنترون RF مزایای مضاعفی را نیز به همراه دارد از قبیل استفاده از تارگت‌های نارسانا، اثرات باردهی^۲ و کاهش تشکیل قوس^۳ به دلیل بهره‌گیری از میدان

¹ Spiral

² Charge-up effects

³ Arching



کامپوزیت HA/Ti را مورد مطالعه قرار دادند. ایشان مشاهده کردند که با افزودن ۱۰ درصد حجمی از پودر Ti در تارگت، بهینه‌ترین خواص مکانیکی از قبیل صافی سطح، چسبندگی پوشش به زیرلایه و عدم وجود ترک بدست آمد [۱۰].

در جهت ارتقاء و بهبود خواص مکانیکی پوشش‌های هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژهای تیتانیم، محققان به سمت استفاده از پوشش‌های چند لایه رفتند که در آن‌ها لایه بیرونی HA توسط یک لایه میانی به زیرلایه تیتانیم متصل می‌گردد. در تحقیقی که توسط Nelea و همکارانش انجام گرفت، پوششی از هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه F-Ti-5Al-2.5F به روش کند و پاش RF ایجاد گردید. در این جا اثر وجود و عدم وجود لایه میانی^۴ بر خواص مکانیکی این پوشش مورد مطالعه بوده است. ایشان دریافتند که وجود لایه میانی TiN موجب بهبود و ارتقاء خواص مکانیکی پوشش به ویژه سختی، سفتی و نیز رسیدن به پوششی با تراکم بالاتر شده است [۱۵].

در همین زمینه Lin و همکارش پوشش دو لایه‌ای از HA و TiO_2 را با روش تراسب الکتروولیت^۵ بر روی زیرلایه تیتانیمی ایجاد کردند. آن‌ها مشاهده کردند که وجود لایه میانی TiO_2 موجب پایدار شدن پوشش هیدروکسی آپاتیت و جلوگیری از استحاله فاز در دماهای بالا می‌گردد و نیز زیست‌فالی بیشتری را نسبت به زیرلایه تیتانیمی موجب می‌گردد. همچنین مشاهده گردید وجود لایه میانی TiO_2 موجب افزایش چشمگیر استحکام چسبندگی پوشش HA از ۱۱/۳ MPa به ۴۶/۷ MPa شده است [۱۶].

در مطالعه دیگری، مقایسه‌ای میان انواع پوشش تک لایه

بنابراین، کاشتنی‌هایی (عمدتاً آلیاژ تیتانیم) با پوشش‌های سرامیکی بسیار خوبی برای کابردۀای دائمی دندانی و اورتودونتی در دسترس خواهد بود [۴].

در همین راستا، در برخی از مطالعات، با پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی زیر لایه تیتانیمی به روش کند و پاش RF^۱ در فشارهای مختلف آرگون نشان داده شده است که در فشارهای بالا، اثر متناقضی بروز می‌کند. از یک طرف، افزایش میزان گاز یونیزه آرگون و در پی آن ایجاد پوششی دهی بهتر و بیشتر صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، این افزایش فشار منجر به تجزیه HA به فازهای دیگری مانند β -TCP و β -PYR و TTCP و CaO می‌گردد. در این میان، CaO به دلیل واکنش در بدن موجود زنده و ایجاد مشکلاتی نظریه التهاب، سوزش و مسمومیت^۲ (عدم زیست‌سازگاری) در بدن، فازی نامطلوب در پوشش‌های فسفات کلسیم می‌باشد. به منظور شناسایی فازهای متعدد تشکیل شده در پوشش به روش کند و پاش، از پراش اشعه ایکس (XRD) بهره گرفته می‌شود. اما از آنجایی که شناسایی فاز و به ویژه فاز نامطلوب CaO در اسکن نرمال به دلیل نازک بودن پوشش دشوار است، از XRD در زوایای پایین^۳ استفاده می‌گردد [۸].

همچنین مشاهده شده است که پوشش‌های HA خواص مکانیکی ضعیف داشته و ترد و شکننده می‌باشند [۹-۱۴] و در ضخامت‌های کمتر از ۱ μm سرعت انحلال آن‌ها در بافت موجود زنده بالاتر است که این مطلوب نیست [۹]. در همین راستا، Ding و همکارانش ایده بهره‌گیری از

¹ Radio Frequency

² Poisoning of Cells

³ Low-Angle X-Ray Diffraction

⁴ Buffer layer

⁵ Electrolytic deposition



درون خشک کن قرار داده شد تا اتانول باقی مانده بر سطح آنها حذف گردد.

جهت ساخت تارگتی از HA، از پودر هیدروکسی آپاتیت Berkeley Advanced ساخت شرکت آمریکایی Biomaterials (BABI-HAP-SP) کد (BABI-HAP-SP) با متوسط اندازه ذرات $5 \mu\text{m}$ و سطح ویژه $10 \text{ m}^2/\text{g}$ استفاده گردید. پس از پرس پودر HA در فشار ۲۰ bar، قرص خام HA درون کوره الکتریکی قرار داده شد تا در دمای 500°C زینترینگ آن انجام گردد.

در ادامه زیرلایه‌های تیتانیمی و تارگت HA درون محفظه دستگاه کند و پاش مگنترون RF (ساخت شرکت یار نیکان صالح، ایران) قرار داده شدند. سپس با ایجاد خلاء 10^{-7} Torr و تزریق گاز آرگون با فشاری برابر با $10^{-7} \times 10^{-7}$ Torr شرایط برای آغاز فرآیند کند و پاش فراهم گردید.

در اینجا چند نمونه پوشش داده شده مد نظر بوده است. سه نمونه پوشش HA تنها^۳ بر روی زیرلایه تیتانیمی در سه H1، H2 و H3. همچنین برای تعیین شرایط بهینه برای ایجاد پوشش TiO_2 به عنوان لایه میانی برای نمونه نهایی چند لایه^۴، یک تارگت از تیتانیم خالص (ساخت شرکت یار نیکان صالح، ایران) درون دستگاه کند و پاش مگنترون قرار داده شد و با اعمال جریان مستقیم (DC) 0.18 A فرآیند ایجاد پوشش تیتانیا بر روی زیرلایه تیتانیمی انجام گردید. برخلاف فرآیند RF، در اینجا با اعمال جریان DC و اعمال اتمسفری از مخلوط دو گاز آرگون و اکسیژن فرآیند

functional graded HA, TiO_2 و پوشش HA از TiO_2 , HA و HA/ TiO_2 که با روش رسوبدهی الکتروفورتیک^۱ پوشش دهی شدند، انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش functional graded مت Shankl از HA, TiO_2 و HA از استحکام چسبندگی بیشتری نسبت به دو پوشش دیگر برخوردار بوده است (۳۱ MPa) به ترتیب در مقایسه با ۲۶ MPa و ۱۱ MPa [۱۷].

در تحقیق حاضر، نمونه‌های مختلفی با زیرلایه ۴V و پوشش‌های اکسید تیتانیم و هیدروکسی آپاتیت با روش کند و پاش مگنترون و در اتمسفری با نسبت‌های مختلفی از آرگون و اکسیژن تهیه گردیدند تا بدین طریق اثر انواع پوشش‌ها و به ویژه وجود لایه میانی در خواص پوشش هیدروکسی آپاتیت بر آلیاژ مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

۲- فعالیت‌های تجربی

۲-۱- مواد اولیه و سنتز نمونه‌ها

در این تحقیق، هدف ایجاد لایه‌های نازکی از هیدروکسی آپاتیت و تیتانیا بر روی زیرلایه ۴V-Ti-6Al با روش کند و پاش مگنترون RF و DC می‌باشد. بدین منظور و با استفاده از روش Wire-Cut زیرلایه‌هایی به شکل قرصی‌هایی با قطر 18mm و ضخامت 6mm از استوانه‌ای از آلیاژ F136، Friadent GmbH, Mannheim, (6Al-4V Germany) برداشته شد. پس از آماده‌سازی سطح با پولیش (با کاغذ سمباده SiC در گریدهای ۳۴۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰) و شستشوی آنها با اتانول، زیرلایه‌ها

³ Monolithic
⁴ Multilayer

¹ Electrophoretic Deposition Technique (EPD)
² Grade



اندازه‌گیری ضخامت آن‌ها از میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FE-SEM)^۲ مدل MIRA 3-XMU ساخت شرکت TESCAN (جمهوری چک) مجهز به EDS استفاده شد. همچنین برای بررسی سطوح نمونه‌هایی که جهت شبیه‌سازی شرایط بدن انسان درون مایع SBF قرار داده شده بودند، از SEM مدل VEGAIII ساخت شرکت TESCAN بهره گرفته شد.

برای بررسی‌های توپوگرافی و زبری^۳ سطوح پوشش‌ها از AutoProbe میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)^۴ مدل Park Scientific Instruments CP ساخت شرکت CP (آمریکا) استفاده گردید.

۳-۲- آزمون خوردگی

در اینجا نمونه‌های مورد نظر درون یک بشر حاوی محلول شبیه‌سازی بدن انسان (SBF)^۵ (با مشخصات جدول ۱) که توسط نگارنده در آزمایشگاه ساخته شد، قرار داده شدند. با قرار دادن یک الکترود مرجع کالومل (SCE) برای تعیین ولتاژ نسبت به آن، یک کانترالکترود^۶ در محلول (پلاتین) و الکترود کاری (Ti-6Al-4V) یا همان زیرلایه ووصل EG&G نمودن همه آن‌ها به دستگاه پتانسیواستات مدل mV/s ۲۷۳A و اعمال نرخ ولتاژ ۱ mV/s در بازه پتانسیل ۱۰۰-۱۰۰ mV^۷ نسبت به پتانسیل مدار باز (OCP) این آزمایش انجام گرفت. در این مرحله داده‌هایی به صورت نمودار ولتاژ (E_{corr}) بر جریان (I_{corr}) بدست می‌آید. سپس

کند و پاش رخ می‌دهد. بدین صورت که در اثر گازهای یونیزه، اتم‌های Ti از سطح تارگت جدا شده و در حین نشستن بر سطح زیرلایه با اکسیژن موجود در اتمسفر واکنش داده و اکسید می‌شوند. بدین ترتیب لایه اکسید تیتانیم بر روی زیرلایه ایجاد می‌گردد.

در اینجا سه نمونه پوشش تیتانیمی تنها بر روی زیرلایه تیتانیمی در سه نسبت مختلف ۷۰/۳۰، ۵۰/۵۰، ۳۰/۷۰ از دو گاز به ترتیب آرگون و اکسیژن ایجاد گردید (کد نمونه‌ها T1، T2 و T3).

برای پوشش‌دهی نمونه چند لایه که در آن HA لایه نازک بیرونی و TiO_2 به عنوان لایه میانی اتصال دهنده هیدروکسی آپاتیت به زیرلایه Ti-6Al-4V می‌باشد، پارامترهای بهینه پوشش‌دهی بدست آمده برای هر دو ماده اعمال گردیدند (کد نمونه‌ها ML0). در ادامه برای بررسی اثر عملیات حرارتی مجدد بر روی پوشش‌های ایجاد شده، نمونه‌های چند لایه داخل کوره الکتریکی به مدت ۱ ساعت به ترتیب در دماهای ۵۰۰°C و ۸۰۰°C قرار گرفتند (کد نمونه‌ها به ترتیب ML500 و ML800). در انتها تمامی نمونه‌ها با روش‌های متعدد ذیل مورد آنالیز قرار گرفتند.

۲-۲- تعیین خواص

به منظور بررسی فازهای تشکیل شده از دستگاه اشعه ایکس (XRD) مدل X'Pert^۳ MRD ساخت شرکت Panalytical استفاده گردید. این دستگاه دارای قابلیت اسکن نرمال و نیز grazing (به TF-XRD هم خوانده می‌شود)^۱ می‌باشد.

برای بررسی‌های مورفولوژیکی سطوح پوشش‌ها و نیز

¹ Thin Film XRD

² Field emission scanning electron microscope

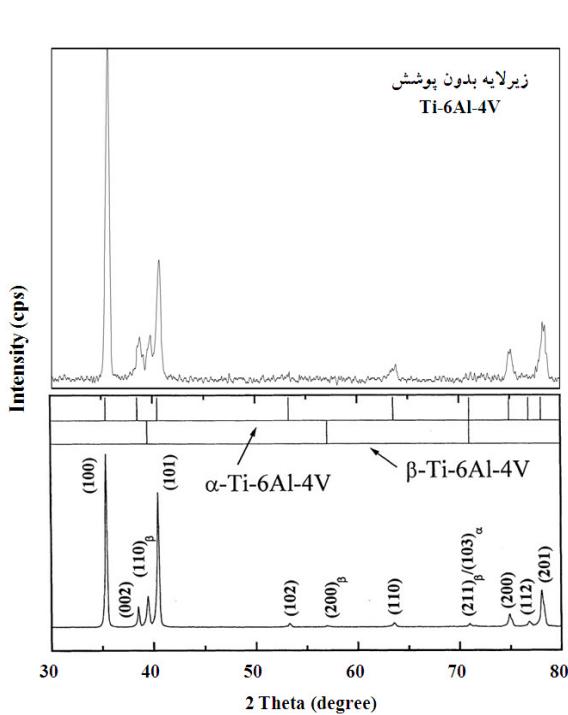
³ Roughness

⁴ Atomic Force Microscope

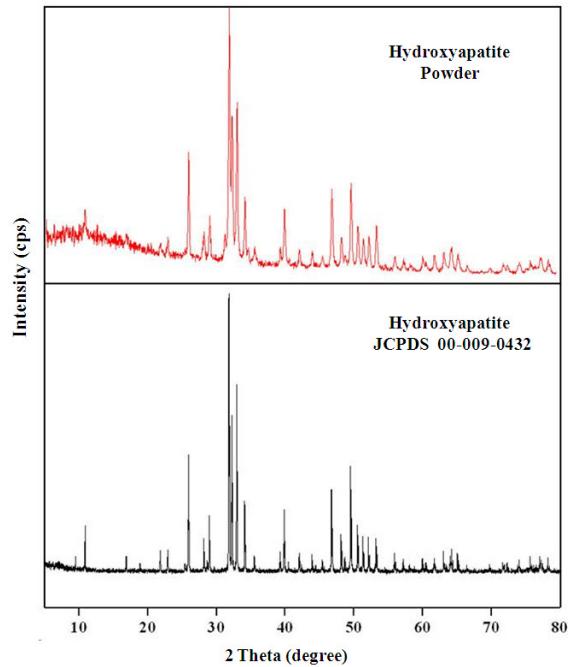
⁵ Simulated Body Fluid

⁶ Counter-electrode

⁷ Open circuit potential



شکل ۱- طیف XRD زیرلایه ۴V-Ti-6Al



شکل ۲- الگوی XRD پودر هیدروکسی آپاتیت.

این داده‌ها با محاسباتی به صورت نمودار ولتاژ بر حسب
دانسیته جریان (A.cm^{-2}) رسم و گزارش می‌گردند.

جدول ۱- مشخصات محلول SBF مورد استفاده و مقایسه
آن با پلاسمای خون انسان.

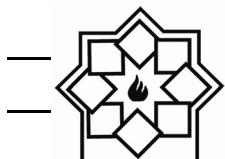
یون	مایع شبیه‌سازی بدن انسان	پلاسمای خون (SBF)	غلظت یون (mmol/dm^3)
Na^+	۱۴۲/۰	۱۴۲/۰	
K^+	۵/۰	۵/۰	
Mg^{2+}	۱/۵	۱/۵	
Ca^{2+}	۲/۵	۲/۵	
Cl^-	۱۰۳/۰	۱۴۷/۸	
HCO_3^{-1}	۲۷/۰	۴/۲	
HPO_4^{-2}	۱/۰	۱/۰	
SO_4^{-2}	۰/۵	۰/۵	

۳- نتایج و پژوهش

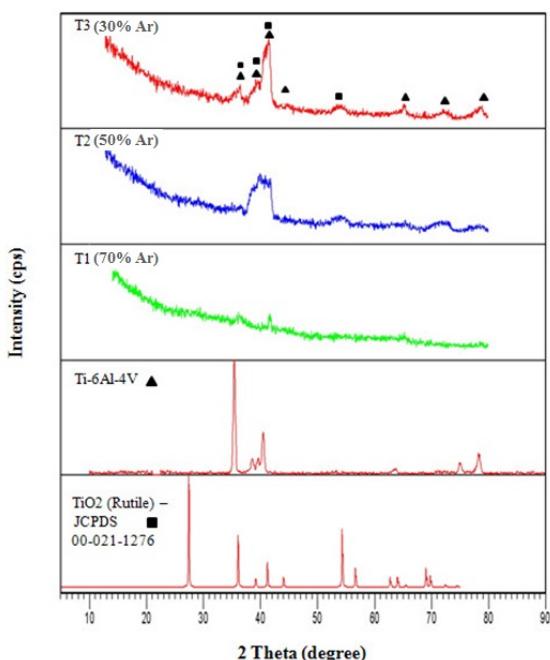
۱-۳- آنالیز فازی (XRD)

شکل (۱) طیف پراش اشعه ایکس (XRD) مربوط به زیرلایه آلیاژ Ti-6Al-4V را نشان می‌دهد. با توجه به عدم وجود یک الگوی مرجع مشخص برای آلیاژ Ti-6Al-4V در نسخه پایگاه داده مورد استفاده در این تحقیق، از الگوی ارائه شده در مرجع [۱۸] بهره گرفته شد.

در شکل (۲) طیف XRD پودر هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده در ساخت تارگت HA نشان داده شده است که با مقایسه آن با الگوی مرجع ۰۰-۰۰۹-۰۴۳۲ JCPDS مشخص می‌شود که پودر مورد استفاده دقیقاً هیدروکسی آپاتیت بوده و خلوص بسیار بالایی داشته است.



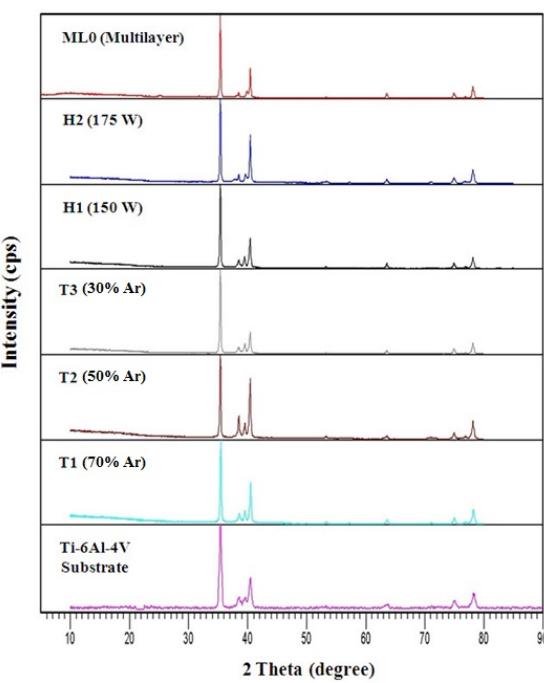
یا این که ناشی از انجام آزمون اشعه ایکس grazing می‌باشد. در الگوی پراش نمونه T1 که بیشترین میزان آرگون در گاز مخلوط تزریقی به محفظه دستگاه کند و پاش را دارد، هیچ‌گونه پیک واضحی دیده نمی‌شود. مشاهده می‌شود که با کاهش میزان گاز آرگون، پیک‌های مربوط به زیرلایه Ti-6Al-4V و روتایل به طور واضح‌تری قابل مشاهده هستند. بنابراین، با این استناد و با توجه به پیک‌های بلندتر نمونه T3، این نمونه به عنوان نمونه بهینه در تعیین شرایط پوشش‌دهی تیتانیا به روش کند و پاش بر روی زیرلایه تیتانیمی معرفی می‌گردد.



شکل ۴- طیف XRD نمونه‌های با پوشش‌های تک لایه تیتانیا به همراه طیف XRD مربوط به Ti-6Al-4V و الگوی مرجع روتایل.

الگوی XRD مربوط به نمونه‌های دارای پوشش HA یعنی H1، H2 و ML500 در شکل (۵) آمده است. در شکل مذکور الگویی برای نمونه H3 وجود ندارد. دلیل این

شکل (۳) الگوی XRD نرمال تمامی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل دیده می‌شود، الگوی همه نمونه‌ها یکسان است و اثری از فازهایی مانند HA و TiO_2 نیست که می‌تواند به دلیل ضخامت بسیار کم لایه‌های نازک پوشش داده شده باشد. از این رو و برای بررسی فازهای محتمل و مورد نظر از پراش اشعه ایکس در زوایای پایین بهره گرفته شد.

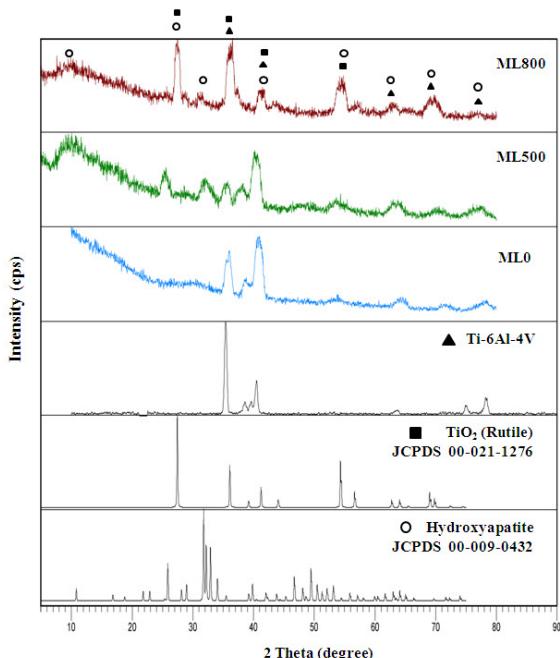


شکل ۳- الگوی XRD نرمال تمامی نمونه‌ها.

طیف پراش اشعه ایکس در زاویه پایین برای نمونه‌های با پوشش تک لایه تیتانیا (T3، T2 و T3) به همراه الگوی مربوط به زیرلایه تیتانیمی و الگوی مرجع JCPDS 00-021-1276 در شکل (۴) ارائه شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، در زوایای کمتر از ۳۳ درجه از الگوی تمامی نمونه‌ها پیک واضحی دیده نمی‌شود. این امر می‌تواند به این دلیل باشد که یا فاز آمورف در پوشش وجود دارد و



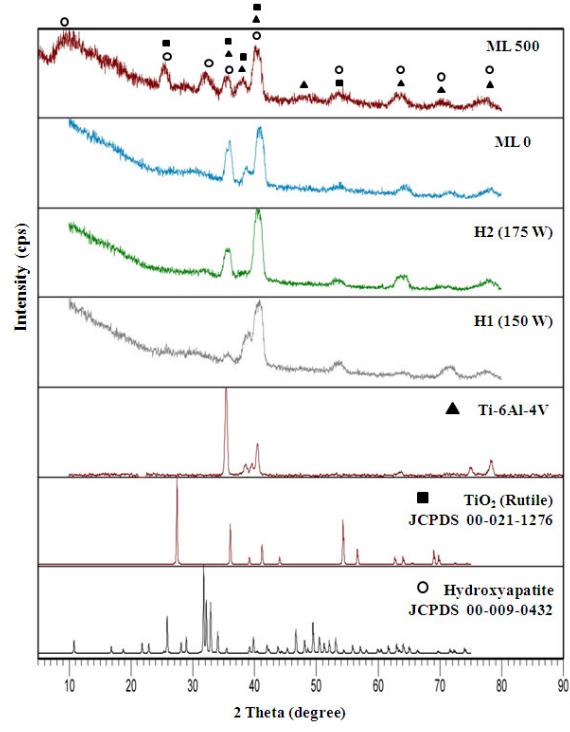
الگوهای XRD مربوط به نمونه‌های چند لایه ML0 و ML500 و ML800 در شکل (۶) نشان داده شده است. در اینجا با افزایش دمای عملیات حرارتی پیک‌های مربوط به هیدروکسی آپاتیت رشد کرده‌اند که نشان از افزایش بلورینگی و رشد بلورک‌ها و دانه‌های HA دارد.



شکل ۶- الگوی XRD نمونه‌های دارای پوشش چند لایه ML800، ML500 و ML0 به همراه الگوی زیرلایه، الگوی مرجع تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت.

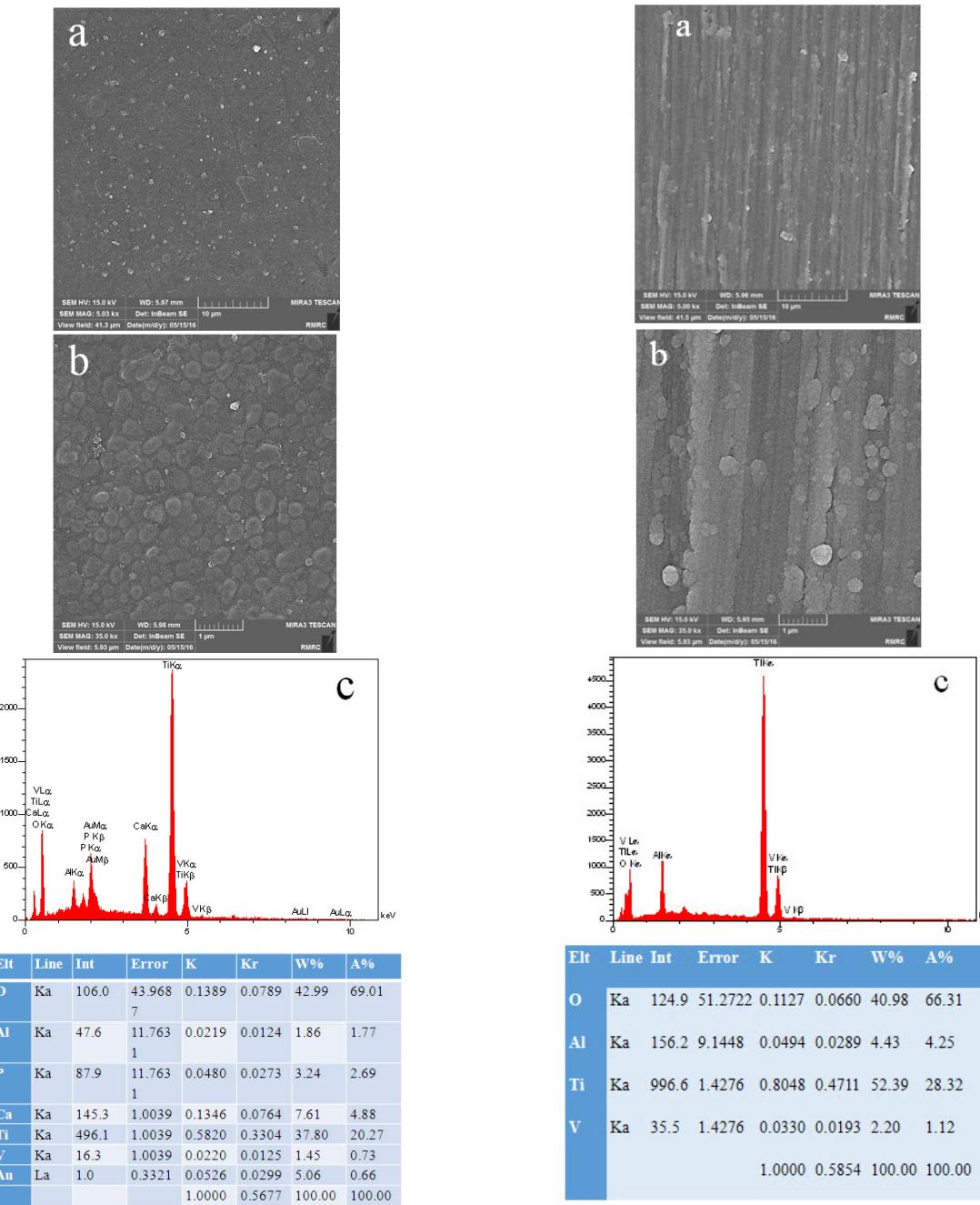
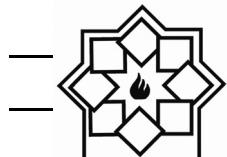
شکل (۷) تصاویر FE-SEM از سطح نمونه بهینه T3 و آنالیز EDS را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نتایج آنالیز EDS تایید کننده نتایج XRD در تشکیل وجود لایه تیتانیا بر روی زیرلایه تیتانیمی می‌باشد. همچنین از تصاویر SEM می‌توان ادعا کرد که لایه تیتانیا به صورت نسبتاً یکنواخت و نسبتاً متراکم بر روی زیرلایه تشکیل شده است.

امر از بین رفتن تارگت هیدروکسی آپاتیت در توان W ۲۰۰ در طی فرآیند کند و پاش می‌باشد. همچنین مشاهده می‌شود که برای نمونه‌هایی که فقط پوشش‌دهی در مورد آن‌ها انجام پذیرفته است، فاز هیدروکسی آپاتیت (HA) به طور واضحی دیده نمی‌شود. دلیل این امر می‌تواند وجود فاز آمورف یا فازی با بلورینگی^۱ پایین (اندازه بلورک‌های نانو) باشد. اما برای نمونه ML500 که در دمای 500°C به مدت ۱ ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است، پیک‌های مربوط به فاز هیدروکسی آپاتیت به خوبی به وجود آمده، رشد کرده و قابل مشاهده است.



شکل ۵- الگوی XRD نمونه‌های دارای پوشش HA به همراه الگوی زیرلایه، الگوی مرجع تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت.

¹ Crystallinity

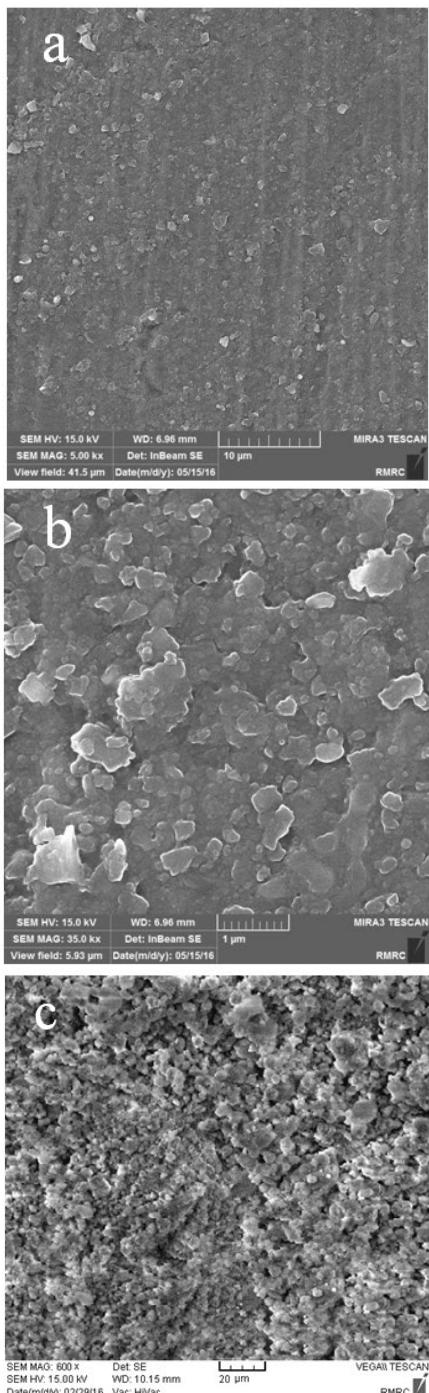


شکل ۸- تصاویر FE-SEM از سطح نمونه دارای پوشش بهینه هیدروکسی آپاتیت (کد H2) در بزرگنمایی های مختلف و به همراه آنالیز EDS.

تصاویر SEM مذکور از تشکیل لایه هیدروکسی آپاتیت حکایت دارند. ولی این لایه از تراکم عالی برخوردار نبوده و

شکل ۷- تصاویر FE-SEM از سطح نمونه پوشش داده شده با تیتانیا (کد T3) در بزرگنمایی های مختلف و به همراه آنالیز EDS.

تصاویر FE-SEM از نمونه های هیدروکسی آپاتیت به همراه آنالیز EDS مربوط به آنها در شکل (۸) نشان داده شده است.

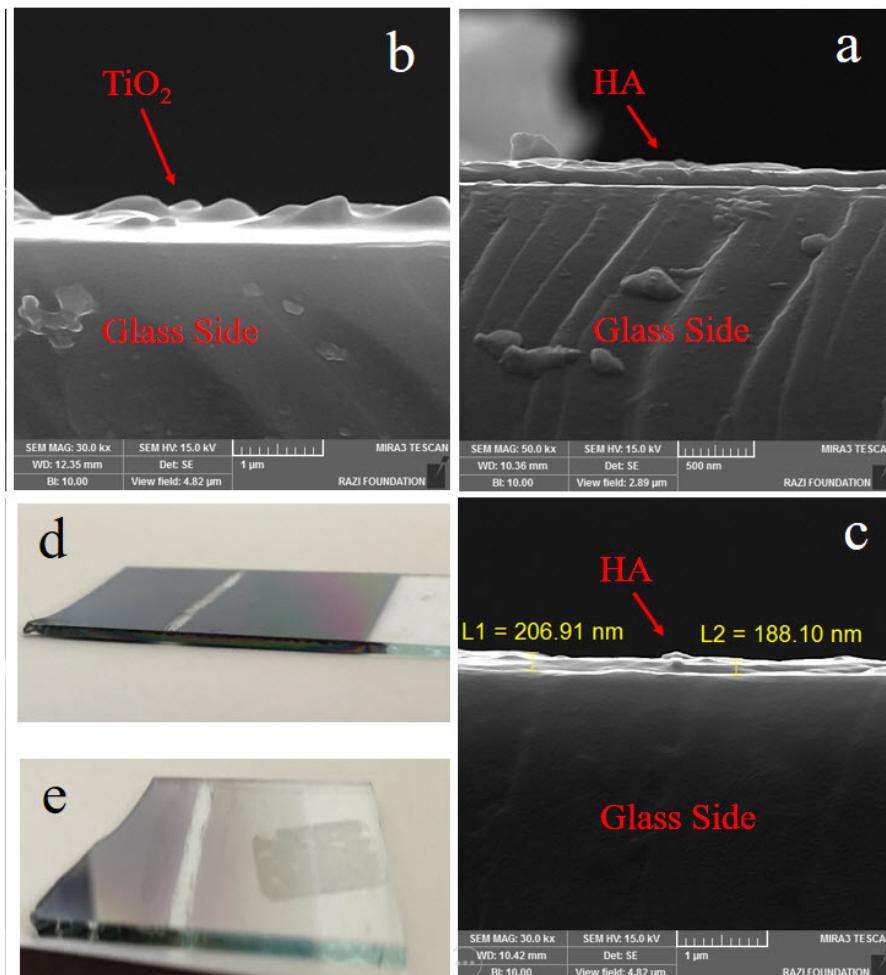
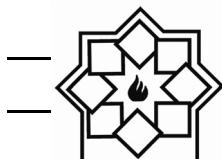


شکل ۹ - (a) و (b) تصاویر FE-SEM از سطح نمونه $\text{ML}0$ در بزرگنمایی‌های مختلف و (c) تصویر SEM از سطح نمونه $\text{ML}500$.

در برخی قسمت‌ها فواصلی میان دانه‌های هیدروکسی آپاتیت دیده می‌شود که این امر می‌تواند ناشی از رفتار ذاتی HA باشد که در هنگام پوشش دهی به صورت جزیره‌ای (کلونی) بر روی زیرلایه می‌نشیند. دلیل محتمل دیگری که می‌توان در نظر گرفت، تنش به وجود آمده در پوشش دهی HA طی فرآیند کند و پاش RF می‌باشد.

در شکل (۹) تصاویر FE-SEM از سطح نمونه چند لایه $\text{ML}0$ در دو بزرگنمایی متفاوت و نیز تصویر SEM مربوط $\text{ML}500$ به سطح نمونه چند لایه عملیات حرارتی شده آورده شده است. همان طور که ملاحظه می‌گردد با انجام عملیات حرارتی، دانه‌ها رشد کرده و بلورینگی پوشش هیدروکسی آپاتیت افزایش یافته است.

تصاویر SEM از سطح مقطع نمونه‌های تک لایه HA و TiO_2 در شکل (۱۰) نمایش داده شده است. این تصاویر مربوط به نمونه‌های دارای زیرلایه شیشه‌ای است که همزمان در کنار نمونه‌های با زیرلایه تیتانیمی پوشش دهی شده‌اند. مطابق این تصاویر، پوشش HA از ضخامت متوسطی در حدود 200 nm برخوردار است. این تصاویر نشان می‌دهند که پوشش تیتانیا دارای پستی و بلندی بسیاری می‌باشد که این خود می‌تواند در افزایش استحکام مکانیکی (چسبندگی) پوشش HA بر روی زیرلایه $\text{Ti}-6\text{Al}-4\text{V}$ به عنوان یک لایه میانی نقش ایفا کند. این در حالی است که لایه هیدروکسی آپاتیت سطح صافتری داشته است. اما از آن جایی که پوشش‌های هیدروکسی آپاتیت بسیار ترد و شکننده‌اند، از این رو نقش یک لایه میانی در استحکام بخشیدن به این انصال حائز اهمیت می‌باشد.

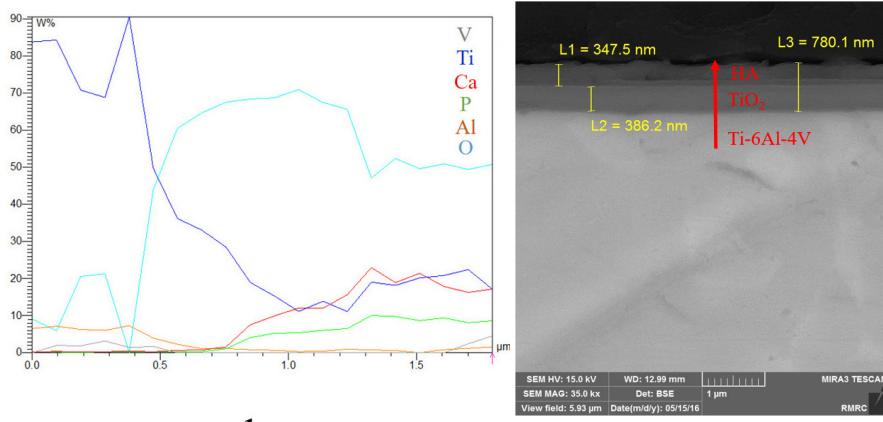
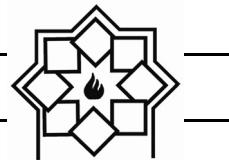


شکل ۱۰- تصاویر FE-SEM از سطح مقطع پوشش‌های HA و TiO_2 بر زیرلايه شيشه‌اي.

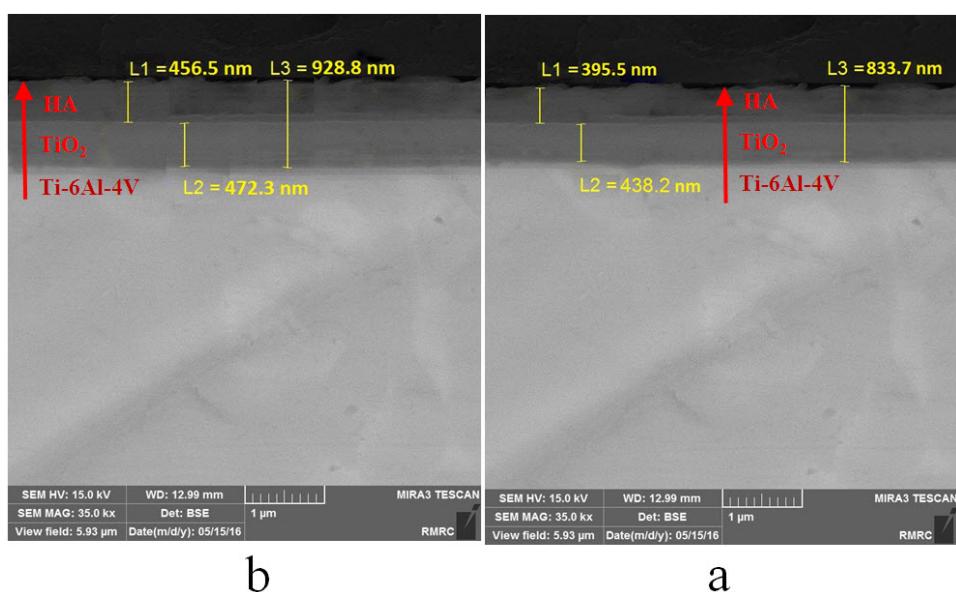
نمونه ML800 ضخامت تیتانیا در حدود ۴۷۲nm و ضخامت لایه HA در حدود ۳۹۳nm و برای نمونه ML500 ضخامت تیتانیا در حدود ۴۵۶nm می‌باشد. این افزایش ضخامت لایه HA در حدود ۴۴۱nm و ضخامت لایه HA در حدود ۳۸۶nm می‌باشد. این افزایش ضخامت هر چند در مقیاس نانو، می‌تواند ناشی از حرارت دهنده بوده باشد.

روند تعییر میزان عناصر در آنالیز EDS به خوبی نشان دهنده این است که پوشش‌های هیدروکسی آپاتیت و تیتانیا بر روی زیرلايه Ti-6Al-4V تشکیل شده‌اند.

شکل (۱۱) تصویر SEM از سطح مقطع پوشش چند لایه HA/TiO₂ بر روی زیرلايه (ML0) Ti-6Al-4V (نمونه ML0) را به همراه آنالیز EDS آن و شکل (۱۲) نیز تصویر SEM از سطح مقطع نمونه چند لایه عملیات حرارتی شده در ۸۰۰°C (ML500) و ۵۰۰°C (ML800) به ترتیب را نشان می‌دهد. در اینجا ملاحظه می‌گردد که برای نمونه ML0 ضخامت پوشش تیتانیا در حدود ۳۴۷nm و ضخامت لایه HA در حدود ۳۹۷nm می‌باشد. همچنان برای نمونه ML500 ضخامت پوشش تیتانیا در حدود



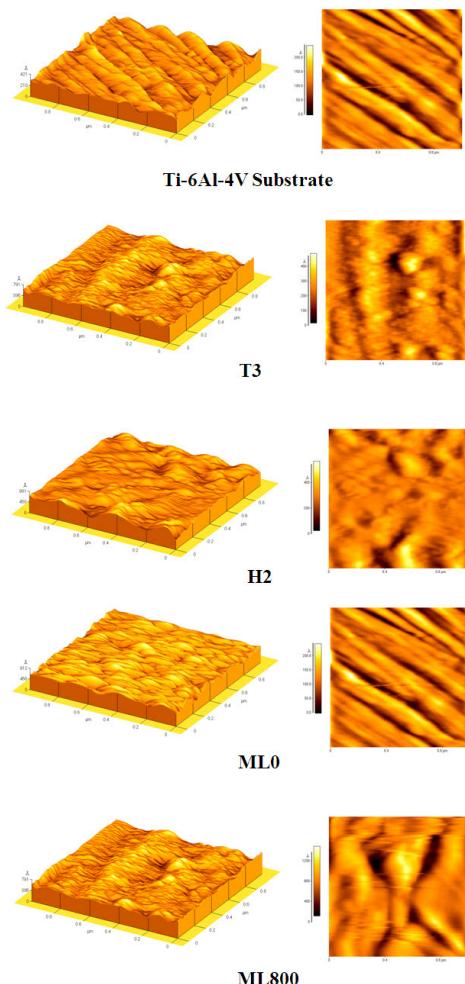
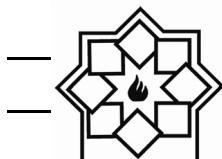
شکل ۱۱ - تصویر FE-SEM از سطح مقطع نمونه چند لایه (ML0) به همراه آنالیز EDS.



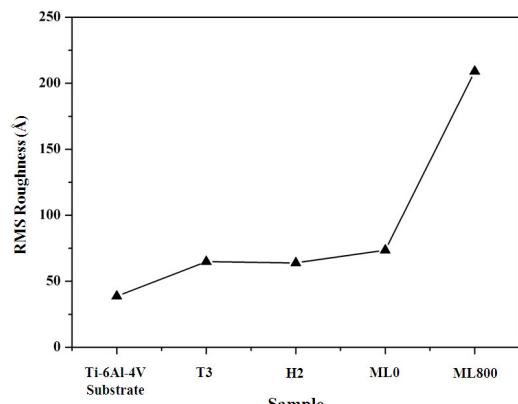
شکل ۱۲ - تصویر FE-SEM از سطح مقطع نمونه چند لایه (a) و (b) ML800 (a) و ML500 (b)

پوشش‌های تک لایه HA/TiO_2 و HA بر زیرلایه تیتانیمی (نمونه ML0)، زبری سطح افزایش داشته است. نتایج عددی گزارش شده در این آزمون در جدول (۲) قابل مشاهده است. در اینجا مشاهده گردید که نمونه‌های H2 و T3 وضعیت مشابه (در حدود 64\AA) ولی بسیار بهتری نسبت به زیرلایه بدون پوشش ($38/7\text{\AA}$) داشته‌اند؛ به نحوی که زبری سطح زیرلایه $38/7\text{\AA}$

در ادامه جهت بررسی توپوگرافی سطح نمونه‌ها، از AFM استفاده شد. تصاویر AFM مربوط به زیرلایه تنها، نمونه‌های با پوشش تک لایه از تیتانیا (T3) و هیدروکسی آپاتیت (H2) در شکل (۱۳) نمایش داده شده است. همان‌طور که در این تصاویر دیده می‌شود، زیرلایه H2 از زبری سطح کمتری نسبت به نمونه‌های Ti-6Al-4V دیگر برخوردار است. این در حالی است که با اعمال



شکل ۱۳ - تصاویر AFM از توپوگرافی سطح زیرلایه و نمونه‌های ML800، ML0 و H2، T3 و .ML800 و ML0



شکل ۱۴ - روند تغییرات زبری سطح زیرلایه و نمونه‌های ML800 و ML0، H2، T3 و .ML800 و ML0

می‌باشد؛ این در حالی است که برای نمونه چند لایه ML0، زبری سطح افزایش معناداری داشته و به مقدار $73/5\text{ }\text{\AA}$ رسیده است. این افزایش حاکی از کاهش تخلخل در سطح پوشش دو لایه HA/TiO₂ می‌باشد. در مورد نمونه ML800 زبری سطح برابر با $20.9\text{ }\text{\AA}$ بود که افزایش شدید (نزدیک به ۳ برابر) و قابل توجهی می‌باشد. این افزایش به صورت سطحی منسجم‌تر و یکنواخت‌تر در شکل (۱۳) به خوبی قابل مشاهده است. این بدان معنا است که انجام عملیات حرارتی در دمای بالا به شدت خواص سطحی پوشش هیدروکسی آپاتیت را بهبود می‌بخشد. روند تغییرات فوق الذکر به صورت نموداری در شکل (۱۴) نشان داده شده است.

جدول ۲ - داده‌های زبری سطح RMS و متوسط مربوط به زیرلایه و نمونه‌های T3، H2 و .ML800 و ML0 و ML0

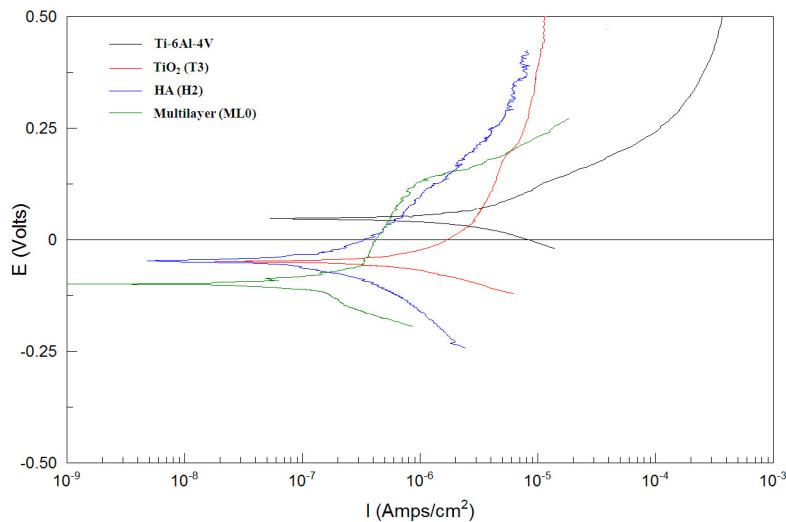
Average Rough (Å)	RMS Rough (Å)	نمونه
۳۱/۰	۳۸/۷	زیرلایه Ti-6Al-4V
۵۱/۴	۶۴/۸	T3
۴۶/۶	۶۳/۹	H2
۵۶/۸	۷۳/۵	ML0
۱۶۰	۲۰۹	ML800



می‌باید. در میان دو پوشش تک لایه تیتانیا (T3) و هیدروکسی آپاتیت (H2)، هیدروکسی آپاتیت رفتار خودگی بهتری را از خود نشان داده است به طوری که نقطه تلاقی فوق الذکر برای نمونه H2 پایین‌تر از نمونه T3 بوده است که اثر مثبت اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت در اصلاح رفتار خودگی آلیاژ Ti-6Al-4V را نشان می‌دهد. همچنین مشاهده می‌گردد که با اعمال پوشش چند لایه HA/TiO₂ بر روی آلیاژ تیتانیم، به شدت مقاومت به خودگی بهبود یافته است.

۳-۳- خودگی در محلول SBF

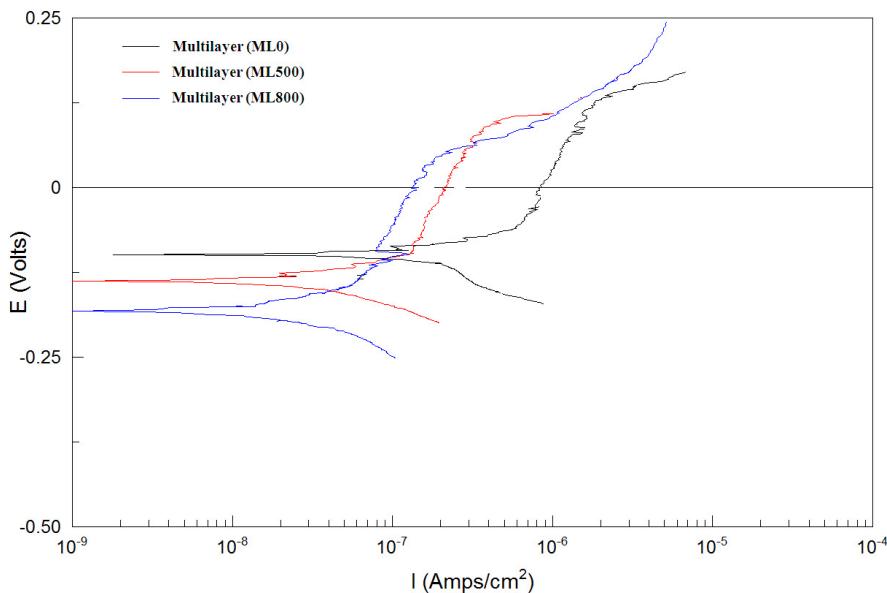
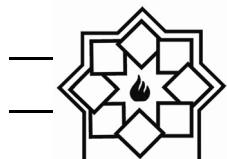
نتایج حاصل از آزمایش خودگی زیرلایه ۴V و نمونه‌های T3، H2، ML0 در شکل (۱۵) نشان داده شده است. در این آزمایش نقطه تلاقی شیب دو منحنی (I_{corr}) معیار سنجش مقاومت به خودگی است؛ به طوری که هر چه این نقطه به سمت دانسیته جریان (محور افقی نمودار) پایین‌تری باشد، مقاومت به خودگی بیشتر و بهتر خواهد بود. همان طور که مشاهده می‌شود با اعمال پوشش بر روی زیرلایه ۴V مقاومت به خودگی بهبود



شکل ۱۵- منحنی رفتار خودگی زیرلایه ۴V-Ti-6Al-4V و نمونه‌های H2، T3 و ML0

ML500 می‌باشد. این بدین معنی است که با اعمال دماهای بالاتر در عملیات حرارتی نمونه‌های چند لایه، مقاومت به خودگی بهبود قابل توجهی می‌باید. در جدول (۳) اعداد مربوط به پتانسیل (E_{corr}) و دانسیته جریان خودگی (I_{corr}) استخراج شده از منحنی‌های شکل‌های (۱۵) و (۱۶) ارائه گردیده است. همان‌طور که در بالا نیز بدان اشاره گردید، هر چه مقدار I_{corr} کم‌تر باشد، مقاومت به خودگی بیشتر خواهد بود.

شکل (۱۶) نمودار رفتار خودگی نمونه‌های با پوشش چند لایه HA/TiO₂ پس از انجام عملیات حرارتی (نمونه‌های ML500 و ML800) را در مقایسه با رفتار خودگی نمونه چند لایه بدون عملیات حرارتی (ML0) نشان می‌دهد. در شکل مذکور به خوبی می‌توان مشاهده کرد که انجام عملیات حرارتی بر روی پوشش موجب بهبود مقاومت به خودگی می‌شود. همچنین می‌توان دید که نمونه ML800 دارای مقاومت به خودگی بسیار بهتری نسبت به نمونه



شکل ۱۶- منحنی رفتار خوردگی نمونه‌های ML0، ML500 و ML800.

جدول ۳- مقادیر پتانسیل و دانسیته جریان خوردگی.

نمونه	I_{corr} ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)	E_{corr} (mv.vs SCE)
Ti-6Al-4V	۰/۴۶۲	۴۷
T3	۰/۲۰۲	-۴۸/۵
H2	۰/۰۴۱	-۴۷
ML0	۰/۰۱۵	-۹۸/۵
ML500	۰/۰۰۷	-۱۳۷/۵
ML800	۰/۰۰۳	-۱۸۱

هیدروکسی آپاتیت توان W ۱۷۵ بود. نتایج XRD وجود فاز هیدروکسی آپاتیت در نمونه‌های تک لایه هیدروکسی آپاتیت با توان پوشش دهنده W ۱۷۵ و چند لایه عملیات حرارتی نشده و عملیات حرارتی شده در دماهای به ترتیب ۵۰۰°C و ۸۰۰°C و فاز تیتانیا در نمونه تک لایه تیتانیا و تمامی نمونه‌های چند لایه را نشان داد. همچنین رشد هیدروکسی آپاتیت با اعمال و افزایش دمای عملیات حرارتی

۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق پوشش‌های تک لایه و چند لایه از تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه Ti-6Al-4V با روش کند و پاش مگنترون DC و AC (RF) ایجاد گردیده و پارامترهای بهینه آن‌ها بدست آمد که برای نمونه تک لایه تیتانیا نسبت اتمسفر Ar/O₂ ۳۰/۷۰ و برای نمونه تک لایه

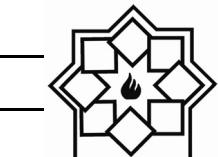


- Engineering, Romania, 2011.
- [5] Lo, W. J., Grant, D. M., Ball, M. D., Welsh, B. S., Howdle, S. M., Antonov, E. N., ... & Popov, V. K., "Physical, chemical, and biological characterization of pulsed laser deposited and plasma sputtered hydroxyapatite thin films on titanium alloy". *Journal of Biomedical Materials Research*, Vol. 50, No. 4, pp. 536-545, 2000.
- [6] Ding, S. J., Properties and immersion behavior of magnetron-sputtered multi-layered hydroxyapatite/titanium composite coatings. *Biomaterials*, Vol. 24, No. 23, pp. 4233-4238, 2003.
- [7] Lundin, D., & Sarakinos, K., "An introduction to thin film processing using high-power impulse magnetron sputtering". *Journal of Materials Research*, Vol. 27, No. 5, pp. 780-792, 2012.
- [8] Ozeki, K., Yuhta, T., Fukui, Y., & Aoki, H., "Phase composition of sputtered films from a hydroxyapatite target", *Surface and Coatings Technology*, Vol. 160, No. 1, pp. 54-61, 2002.
- [9] Ozeki, K., Aoki, H., & Fukui, Y., "Effect of pH on crystallization of sputtered hydroxyapatite film under hydrothermal conditions at low temperature", *Journal of materials science*, Vol. 40, No. 11, pp. 2837-2842, 2005.
- [10] Ding, S. J., Ju, C. P., & Lin, J. H. C., "Characterization of hydroxyapatite and titanium coatings sputtered on $\text{Ti} - 6\text{Al} - 4\text{V}$ substrate", *Journal of Biomedical Materials Research*, Vol. 44, No. 3, pp. 266-279, 1999.
- [11] Mohseni, E., Zalnezhad, E., & Bushroa, A. R., "Comparative investigation on the adhesion of hydroxyapatite coating on $\text{Ti}-6\text{Al}-4\text{V}$ implant: A review paper", *International Journal of Adhesion and Adhesives*, Vol. 48, pp. 238-257, 2014.
- [12] Nelea, V., Morosanu, C., Iliescu, M., & Mihailescu, I. N., "Hydroxyapatite thin films grown by pulsed laser deposition and radio-frequency magnetron

مشاهده گردید. همچنین ملاحظه گردید که فاز هیدروکسی آپاتیت با افزایش دمای عملیات حرارتی و قرارگیری در محلول SBF رشد یافته است. داده‌های AFM از افزایش زبری پوشش از 64\AA برای نمونه تک لایه هیدروکسی آپاتیت، به $73/5\text{\AA}$ و 209\AA به ترتیب برای نمونه‌های چند لایه عملیات حرارتی نشده و عملیات حرارتی شده در دمای 800°C حکایت دارد که خود بیانگر کاهش تخلخل و افزایش انسجام پوشش می‌باشد. با انجام آزمون خوردگی در SBF دانسیته جریان خوردگی کاهش داشته که این امر نشان دهنده افزایش مقاومت به خوردگی با اعمال پوشش چند لایه و نیز اثر به شدت مضاعف عملیات حرارتی در دمای 800°C بر این پارامتر می‌باشد.

مراجع

- [1] Maurya, D. K., Sardarinejad, A., & Alameh, K, "Recent developments in RF magnetron sputtered thin films for pH sensing applications—An overview", "Coatings", Vol. 4, No.4, pp. 756-771, 2014.
- [2] Surmenev, R. A., "A review of plasma-assisted methods for calcium phosphate-based coatings fabrication. *Surface and Coatings Technology*", Vol. 206, No. 8, 2035-2056, 2012.
- [3] Sarakinos, K., Alami, J., & Konstantinidis, S., "High power pulsed magnetron sputtering: A review on scientific and engineering state of the art", *Surface and Coatings Technology*, Vol. 204, No.11, pp. 1661-1684, 2010.
- [4] Constantin, D. G., Apreutesei, M., Awinte, R., Marin, A., Andrei, O. C., & Munteanu, D., "Magnetron Sputtering Technique Used For Coatings Deposition; Technologies And Applications", In 7th International Conference on Materials Science and



- sputtering: comparative study. *Applied Surface Science*, Vol. 228, No. 1, pp. 346-356, 2004.
- [13] Lynn, A. K., & DuQuesnay, D. L., "Hydroxyapatite-coated Ti-6Al-4V: Part 1: the effect of coating thickness on mechanical fatigue behavior", *Biomaterials*, Vol. 23, No. 9, pp. 1937-1946, 2002.
 - [14] Gu, Y. W., Khor, K. A., & Cheang, P., "In vitro studies of plasma-sprayed hydroxyapatite/Ti-6Al-4V composite coatings in simulated body fluid (SBF). *Biomaterials*, Vol. 24, No. 9, pp. 1603-1611, 2003.
 - [15] Nelea, V., Morosanu, C., Iliescu, M., & Mihailescu, I. N., "Microstructure and mechanical properties of hydroxyapatite thin films grown by RF magnetron sputtering", *Surface and Coatings technology*, Vol. 173, No. 2, pp. 315-322, 2003.
 - [16] Lin, C. M., & Yen, S. K., "Characterization and bond strength of electrolytic HA/TiO₂ double layers for orthopaedic applications", *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*, Vol. 16, No. 10, pp. 889-897, 2005.
 - [17] Araghi, A., & Hadianfard, M. J., "Fabrication and characterization of functionally graded hydroxyapatite/TiO₂ multilayer coating on Ti-6Al-4V titanium alloy for biomedical applications", *Ceramics International*, Vol. 41, No. 10, pp. 12668-12679, 2015.
 - [18] Da Silva, S. L. R., Kerber, L. O., Amaral, L., & Dos Santos, C. A., "X-ray diffraction measurements of plasma-nitrided Ti-6Al-4V", *Surface and Coatings Technology*, Vol. 116, pp. 342-346, 1999.